⑩ 日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-152008

⑤Int Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

❷公開 昭和63年(1988)6月24日

G 11 B 5/31

A-7426-5D

審査請求 未請求 発明の数 2 (全5頁)

劉発明の名称 薄膜磁気ヘッドおよびその製造方法

②特 顧 昭61-300561

20出 願 昭61(1986)12月16日

の発明者 中嶋

啓 視

東京都大田区雪谷大塚町1番7号 アルプス電気株式会社

内

切発 明 者 石 橋

直周

東京都大田区雪谷大塚町1番7号 アルプス電気株式会社

内

⑪出 願 人 アルプス電気株式会社

里人 弁理士 河原 純一

東京都大田区雪谷大塚町1番7号

明 福 書

1. 発明の名称

篠膜磁気ヘッドおよびその製造方法

2. 特許請求の範囲

(i) 益板に掌握された溝内に埋め込まれて形成された下部コア層およびリード線層と、

的記載版ならびに前記下部コア層および前記り ード級層上に選択的に形成されたボール部。上下 コアコンタクト部およびコイルコンタクト部と、

前記上下コアコンタクト部および前記コイルコンタクト部を除いて被覆されたギャップ層と、

このギャップ層上に前記ボール部および前記上 下コアコンタクト部にかからないように平面螺旋 状に形成されたコイル層と、

を備えることを特徴とする薄膜磁気ヘッド。 ② 基板に溝を穿及する工程と、

前記簿に下部コア連およびリード線層を埋め込 んで形成する工程と、

前記基板ならびに前記下部コア層および前記リード線層上に選択的にポール部、上下コアコンタ

クト部およびコイルコンタクト部を形成する工程 と、

的配上下コアコンタクト部および胸記コイルコンタクト部を除いてギャップ層を形成する工程と、 前配ボール部および前記上下コフコンタクト部 にかからないように前記ギャップ層上にコイル層 を形成する工程と、

を含むことを特徴とする薄膜磁気へッドの製造 方法。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、薄膜磁気ヘッドおよびその製造方法 に関し、特にフォトリソグラフィ技術を利用して コイルを平面螺旋状に形成する薄膜磁気ヘッドお よびその製造方法に関する。

(従来の技術)

従来、この種の薄膜磁気ヘッドは、第3図に示すように、非磁性基板11と、非磁性基板11上に形成された下部コア層12aおよびリード線層12bと、非磁性基板11ならびに下部コア暦12aおよびリー

(発明が解決しようとする問題点)

上述した従来の薄膜磁気ヘッドでは、第4図に略線的に示すように、絶縁層13、14、16等の周縁部と上部側リード線層17aとの交差部Aやコイルコンタクト部Bで絶縁層13、14、16等の膜厚による段差が生じて上部側リード線層17aやコイル層15、17の崩線が発生しやすいという問題点があっ

記コイルコンタクト部を除いて被覆されたギャップ層と、このギャップ層上に前記ボール部および 前記上下コアコンタクト部にかからないように平 面螺旋状に形成されたコイル層とを備えることを 特徴とする。

また、本発明の寝聴磁気へッドの製造方法は、 基板に沸を穿設する工程と、前記棒に下部コア層 およびリード線層を埋め込んで形成する工程と、 前記基板ならびに前記下部コア層および前記リー ド線層上に選択的にボール部・上下コアコンタクト部およびコイルコンククト部を形成する工程と、 前記上下コアコンタクト部を形成する工程と、 前記ボール部および前記上下コアコンククト部に かからないように前記ギャップ層上にコイル層を 形成する工程とを含むことを特徴とする。

(作田)

本発明の調膜磁気ヘッドでは、下部コア層およびリード線層が基版に穿設された沸内に埋め込まれて形成され、基板ならびに下部コア層およびリ

t.

また、トラック幅を決める上部コア層19のボール部Cで同じく高い段差のために段差下側の寸法 特度が出ないことになり、薄膜磁気ヘッドの性能 および歩望りが低下するという問題点があった。

本発明の目的は、上述の点に置み、薄膜磁気へッドにおける段差を軽減してコイル層の新線の発生を抑制するとともに上部コア層の段差下側における寸法構度が出せるようにした薄膜磁気ヘッドを提供することにある。

また、本発明の他の目的は、上述した磁気へッドを容易に製造可能な薄膜磁気へッドの製造方法 を提供することにある。

(問題点を解決するための手段)

本発明の薄膜磁気ヘッドは、基板に穿換された 律内に埋め込まれて形成された下部コア層および リード線層と、前記基板ならびに前配下部コア層 および前記リード線層上に選択的に形成されたポ ール部、上下コアコンタクト部およびコイルコン タクト部と、前記上下コアコンタクト部および前

ード線層上にボール部、上下コアコンタクト部およびコイルコンタクト部が選択的に形成されており、その分娩緩層による政差が少なくなってコイル層の斯級が少なくなるとともに、上部コア層の改差下側の寸法出しが正確に行えるようになる。

また、本発明の薄膜磁気へッドの製造方法では、 蒸板に沸が穿設され、沸に下部コア層およびリー ド線層が埋め込まれて形成され、基板ならびに下 部コア層およびリード線層上に選択的にボール部、 上下コアコンタクト部およびコイルコンタクト部 が形成され、上下コアコンタクト部およびコイル コンタクト部を除いてギャップ層が形成され、ポ ール部および上下コアコンタクト部にかからない ようにギャップ層上にコイル層が形成される。

(実施例)

次に、本発明について図面を参照しながら説明する。

第1図は、本発明の一実施例に係る疎腹磁気へ ッドを示す断面図である。本実施例の薄膜磁気へ ッドは、非磁性基板(または上面に非磁性層を有 する基板) 1 と、非磁性基板 1 に穿殺された沸 1 a および 1 b 内に埋め込まれて形成された下部コ ア暦 2 m およびリード級層 2 b と、非磁性基板 1 ^{*} ならびに下部コア屋2aおよびリード線層2b上 に選択的に形成されたボール部3a、上下コアコ ンタクト部3bおよびコイルコンタクト部3cと、 上下コアコンタクト部3bおよびコイルコンタク ト部3cを除いて被覆されたギャップ届4と、ギ ャップ層 4 上にボール部 3 まおよび上下コアコン タクト部3bにかからないように平面螺旋状に形 成された1層目のコイル層5と、コイル層5上に 形成された層間絶縁層6と、層間絶縁層6上に平 遊媒旋状に形成された 2 層目のコイル層 7 と、コ イル層1上に形成された層間絶縁層8と、層間絶 経暦8上に形成された上部コア暦9とから、その 主要部が構成されている。

次に、このように構成された本実施例の磁気へ ッドの製造方法について説明する。

まず、非磁性基板1の上面にウェットエッチング、ドライエッチング等により下部コア層 2 a お

るためである。このように、本実施例の復展磁気 ヘッドでは、下部コアが下部コア層 2 a とポール 部 3 a とに分けて形成される。

さらに、SIO。、ARO。等の患者、スパックリング等を選択的に行うことにより、ギャップ 層 4 を形成する。

次に、C u. A & 等の慈若。スパッタリング等を選択的に行うことにより、1 層目のコイル層 5 をボール部 3 a および上下コアコンタクト部 3 b にかからないようにかつコイル層 5 の一幅部がギャップ層 4 に穿殺された透孔を介してコイルコンタクト部 3 c に接触するように平面螺旋状に形成する

続いて、SiO₂, AAO₃, ポリイミド等の 高者, スパッタリング等を選択的に行うことによ り、コイル層 5上に層間絶縁層 6を形成する。

さらに、Cu. Al等の蒸着、スパッタリング 等を選択的に行うことにより、2層目のコイル層 1をコイル層1の一端部が層間絶縁層6に穿設された透孔を介して1層目のコイル層5の一端部に よびリード線層2bの形状の得1aおよび1bを それぞれ穿置する。

次に、パーマロイ、センダスト、C。系アモルファス金属等の磁性材の漂着、スパッタリング等を行うことにより得1。および1bを埋め込み、その上面をドライエッチング、研密等により非磁性基板1の上面と同一面となるように平坦化する。これにより、下部コア層2aおよびリード線層2bが形成される。

統いて、平坦化された非磁性基板 1 上にパーマロイ・センダスト・C o 系アモルファス金属等の磁性材の譲着、スパッタリング等を選択的に行うことにより、ポール部3 a と 下コ アコンタクト部3 c をそれぞれ形成する。このとき、下部コア属 2 a とポール部3 a とは、第 2 図に拡大して示すように、重なり関する。 5 のは、下部コア層 2 a とボール部3 a の膜厚との間とすア層 2 a の膜厚との間とす

接触するように平面保旋状に形成する。

次に、SIO。、AIO。、ポリイミド等の高 着、スペッタリング等を選択的に行うことにより、 コイル層で上に層間絶縁層 8 を形成する。

続いて、パーマロイ、センダスト、Co系アモルファス金属等の磁性材の誘着、スパッタリング等を選択的に行うことにより、上部コア暦 9 を形成する。

この後、保護膜(図示せず)を被覆することに より、本実施例の環膜磁気ヘッドが完成する。

「急時の効果)

以上説明したように、本発明の薄膜磁気ヘッドによれば、リード線層が蒸板に埋め込まれた構造となっているので、リード線層と絶縁層との段差が小さくなってコイルの断線が生じにくくなるとともにコイルコンタクト部における断線も生じにくくなり、断線不良が減少して薄膜磁気ヘッドの歩寄りが著しく向上するという効果がある。

また、下部コア層が基板に埋め込まれ下部コア のポール部が基板より突旋された機道となってい るので、上部コア階のボール部における設差が怪 減されて段差下側の寸法精度が向上し、上部コア 層の形成そのものが容易となって薄膜磁気ヘッド の歩智りの向上および性能の安定化が図れるとい う効果がある。

さらに、磁気ギャップデプス後部の上部コア層 および下部コア層の構造が従来の環度磁気ヘッド より開いた構造となっているので、漏液磁束が小 さくなって薄膜磁気ヘッドの性能を向上させるこ とができる効果がある。

また、本発明の溶験磁気へッドの製造方法によれば、基板上に滞を穿殺し滞内に下部コア層およびリード線層を運め込んで形成するようにしたので、リード線層と絶縁層との段差および上部コア層のボール部における段差の小さな薄膜磁気へッドを容易に製造することができる効果がある。

4. 図面の簡単な説明

第1回は、本発明の一実施例に係る緯度磁気へッドを示す断面図、

第2図は、第1図中における下部コア層とポー

ル都との接続部分の拡大断面図、

第3図は、従来の薄膜磁気へッドの一例を示す 断面図、

第4個は、第3回に示した薄膜磁気ヘッドの略線的平面圏である。

図において、

1・・・・基板、

la, lb·沸、

2 a · · · · 下部コア層、

2 b・・・リード線層、

3a・・・ポール館、

3b・・・上下コアコンタクト部、

3c・・・コイルコンタクト部、

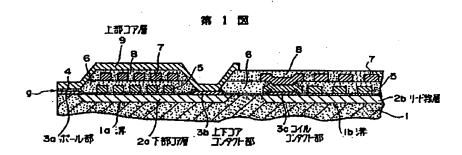
4・・・・ギャップ層、

5. 7・・・コイル層、

5.8···層間絡経度。

9・・・・・上部コア層である。

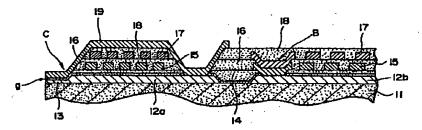
特許出職人 アルプス電気株式会社 代 選 人 弁理士 河 原 雑 一



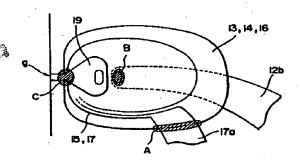
3а 2-6µ п

第 2 図

第 3 図



第 4 図



THIS PAGE BLANK (USPRO)

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-152008

(43)Date of publication of application: 24.06.1988

(51)Int.CI.

G11B 5/31

(21)Application number: 61-300561

(71)Applicant: ALPS ELECTRIC CO LTD

(22)Date of filing:

16.12.1986 (72)Invento

(72)Inventor: NAKAJIMA HIROMI

ISHIBASHI NAOCHIKA

(54) THIN FILM MAGNETIC HEAD AND ITS PRODUCTION

(57)Abstract:

PURPOSE: To easily and possibly produce a thin film magnetic head where a level difference between a lead line layer and an insulation layer and the level difference in the pole part of an upper core layer are small by digging a groove on a substrate and burying a lower core layer and the lead line layer in the groove.

CONSTITUTION: The titled head has the lower core layer 2a and the lead line layer 2b formed by being buried in the grooves 1a and 1b which are digged on a nonmagnetic substrate 1 and also has the pole part 3a, an up-and-down core contact part 3b and a coil contact part 3c formed on the above-mentioned layers 2a and 2b. And coil layers 5 in a first layer, formed spirally in plane, is provided on a gap layer 4 so as not to position on the pole part 3a and the up-and-down core contact part 3b. And a main part is sequentially constituted with the layer insulation layer 6, the coil layers 7 in a second layer, layer insulation layer 8 and the upper core layer 9. Thus the level difference between the lead line layer 2b and the insulation layers 6 and 8 becomes small, so that the disconnection of a coil is not caused so much and also the disconnection in the coil contact part 3c is reduced. As a result, the yield of the thin film magnetic head can be remarkably improved.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

THIS PAGE BLANK USPROV

Japanese Unexamined Patent Application Publication No. 63-152008

2. Claims

(1) A thin-film magnetic head comprising:

a lower core layer and a lead-wire layer embedded in a recess provided in a substrate;

a pole region, an upper-lower core contact region, and a coil contact region that are selectively provided on the substrate, the lower core layer, and the lead-wire layer;

a gap layer provided in a region excluding the upperlower core contact region and the coil contact region; and

a planar spiral coil layer disposed on the gap layer in a manner such that the coil layer does not cover the pole region and the upper-lower core contact region.

(2) A method for manufacturing a thin-film magnetic head comprising the steps of:

forming a recess in a substrate;

embedding a lower core layer and a lead-wire layer in
the recess;

selectively forming a pole region, an upper-lower core contact region, and a coil contact region on the substrate, the lower core layer, and the lead-wire layer;

forming a gap layer in a region excluding the upperlower core contact region and the coil contact region; and THIS PAGE BLANK USPON

forming a coil layer on the gap layer in a manner such that the coil layer does not cover the pole region and the upper-lower core contact region.

THIS PAGE BLAM (USD)O)

•